PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-045015

(43) Date of publication of application: 14.02.2003

(51)Int.Cl.

G11R 5/667 G11B 5/65 G11B 5/738 G11B 5/851 H01F 10/30

(21)Application number: 2001-228788

(71)Applicant: ANELVA CORP

(22)Date of filing:

27.07.2001

(72)Inventor: FURUKAWA SHINJI

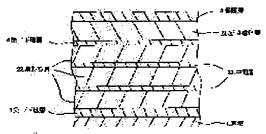
WATANABE NAOKI

(54) PERPENDICULAR MAGNETIC RECORDING MEDIUM AND ITS MANUFACTURING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To achieve low noise in a perpendicular magnetic recording medium.

SOLUTION: A magnetic recording layer formed on a substrate 1 is a perpendicular magnetization layer 21 on which recording is carried out by magnetization in a direction perpendicular to the substrate 1, and a lining layer 22 is provided in the substrate 1 side of the perpendicular magnetization layer 21 so as to set the direction of the magnetization on the perpendicular magnetization layer 2 more in a perpendicular direction. The lining layer 22 is constituted of a plurality of laminated soft magnetic films, and a middle layer 23 is inserted into an interface thereof to suppress the generation of a magnetic wall in the lining layer 22. The middle layer 23 is constituted of a ruthenium film, and a pair of adjacent soft magnetic sandwiching the middle layer are coupled interlayer antiferromagnetically. By the interlayer antiferromagnetic coupling. the generation of the magnetic wall in the lining layer 22 is suppressed, and spike noise generated by the magnetic wall is reduced.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開發号 特開2003-45015 (P2003-45015A)

(43)公開日 平成15年2月14日(2003.2.14)

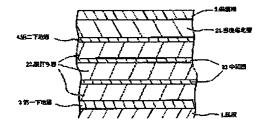
						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
(51) Int.CL'		級別記号	FI			テーマユード(参考)
GllB	5/667		G11B 6/957 5D006			
	5/65			5/65		5D112
	5/733			5/738		5 E 0 4 9
	5/861			5/861		
H01F	10/30		HO1F 10/30			
			審查翻求	未開來	苗求項の数 9	OL (全6頁)
(21)出顧番号		特職2001 - 222788(P2001 - 222788)	(71)出廢人			,
			1	アネルバ	株式会社	
(22)出籍日		平成13年7月27日(2001.7.27)	東京都府中市四谷5丁目8番1			38番1号
			(72) 発明者	古川 真	冏	
			•	東京都府	中市四谷6丁目	38番1号アネルバ
			1	株式会社	内	
			(72) 発明者	被过 直	斷	
				東京都府	中市四谷5丁目	8番1号アネルバ
				株式会社	内	
			(74)代理人	100097548	3	
				弁理士 (保立 浩一	
						最終質に続く

(54) 【発明の名称】 垂直磁気記録媒体及び垂直磁気記録媒体製造方法

(57)【要約】

【課題】 垂直磁気記録媒体において、低ノイズ化を達成する。

【解決手段】 善板1上に形成された磁気記録層は、基板1に垂直な方向での磁化により記録が行われる垂直磁化層21における磁化の方向がより垂直な方向に向くようにする裏打ち層22が垂直磁化層21の基板側1に設けられている。裏打ち層22は積層された複数の執磁性膜より成るものであってそれらの界面には、裏打ち層22における磁壁発生を抑制する中間層23が挿入されている。中間層23はルテニウム膜で形成され、それを挟んで隣接する一対の執磁性膜を層間反強磁性結合させる。層間反強磁性結合により、裏打ち層22における磁壁の発生が抑制され、磁壁により生じていたスパイクノイズが低減される。



【特許請求の範囲】

【 註水項 】 基板と、この基板上に形成された磁気記 録暑とより成り、磁気記録暑は基板に垂直な方向での磁 化により記録が行われる垂直磁化層である垂直磁気記録 雄体であって、

前記垂直磁化層における磁化の方向がより垂直な方向に 向くようにする裏打ち層が垂直磁化層の基板側に設けら れており、

さらに、裏打ち層は綺麗された複数の軟磁性膜より成る ものであってそれら少なくとも一つの界面には、裏打ち 10 るものである。 層における磁盤発生を抑制する中間層が設けられている ことを特徴とする垂直磁気記録媒体。

【請求項2】 前記中間層は、その中間層を挟んで隣接 する一対の前記軟磁性膜を層間反弧磁性結合させるもの であることを特徴とする語求項1記載の垂直磁気記録媒 体.

【論求項3】 前記中間層は、ルテニウム、イリジウ ム、銅、ロジウム、バナジウム、クロム、ニオブ、モリ ブデン、タンタル、タングステン又はレニウムを含む膜 から成ることを特徴とする請求項2記載の垂直磁気記録 20

【請求項4】 前記複数の軟磁性膜は、同じ材料である ことを特徴とする請求項1.2又は3記載の垂直磁気記 绿媒体。

【詰求項5】 墓板と、この基板上に形成された磁気記 録暑とより成り、磁気記録層は基板に垂直な方向での磁 化により記録が行われる垂直磁化層である垂直磁気記録 媒体を製造する垂直磁気記録媒体製造方法であって、 裏打ち層を基板上に形成する裏打ち層形成工程と、

裏打ち層形成工程の後、垂直磁化層を形成する垂直磁化 30 層形成工程とを有しており.

前記裏打ち層形成工程は、軟磁性膜を作成した後、この 上にその軟磁性膜における磁壁発生を抑制する中間層を 形成し、さらにこの中間層の上に別の軟磁性膜を作成す る動作を有することを特徴とする垂直磁気記録媒体製造

【調求項6】 前記中間層は、その中間層を挟んで隣接 する一対の前記軟磁性膜を層間反弧磁性結合させる膜か ち成ることを特徴とする語求項5記載の垂直磁気配縁媒 体製造方法。

【請求項7】 前記中間層形成工程は、前記層間反強磁 性結合させる膜を作成する工程であって、前記別の歓遊 **性膜の上にこの膜を作成する工程と、その上にさらに別** の軟磁性膜を作成する動作を1回以上繰り返すことを特 欲とする請求項6記載の垂直磁気記憶媒体製造方法。

【 請求項8 】 前記層間反弦磁性結合させる膜は、ルテ ニウム、イリジウム、銅、ロジウム、バナジウム、クロ ム、ニオブ、モリブデン、タンタル、タングステン又は レニウムを含む膜であることを特徴とする請求項6又は 7記載の垂直磁気記録媒体製造方法。

【詰求項9】 前記軟磁性層は、すべて同じ材料である ことを特徴とする請求項5乃至8いずれかに記載の垂直 磁気配缘媒体製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の層する技術分野】本願の発明は、コンピュータ の外部記憶装置としてのハードディスク等の磁気記録媒 体に関するものであり、特に、次世代の記録方式として 期待される垂直磁気記録を行う垂直磁気記録媒体に関す

[0002]

【従来の技術】磁気記録媒体は、記憶容置増大の絶えざ る要求の下、年率100%を越える飛躍的な面記録密度 の向上を遂げてきた。現在の面記録密度は35ギガビッ ト/平方インチ程度になっており、将来的には100ギ ガビット/平方インチに達すると言われている。現在市 販されている磁気記録媒体は、長手方向記録方式が殆ど であるが、長手方向記録方式は限界に近づいていると考 えられており、100ギガビット/平方インチを越える 次世代の磁気記録媒体においては、垂直磁気記録方式が 一般的になるとみられている。長季方向記録は、記録面 に沿った特定の方向に磁化して記録するものである。長 手方向記録において面記録密度を高くすることは、磁区 を小さくすることに直結する。このため、長手方向記録 では、微細な磁区を充分に大きな磁場強度で磁区を磁化 することが困難になり、センス電流があまり微弱になっ てしまう。つまり、長手方向記録では、まず磁気ヘッド の側で限界に達すると予想される。

【0003】また、長手方向記録において面記録密度を さらに向上させるには、結晶粒をより微細化することと の関係上、磁気記録層を構成する磁性膜をより薄くする 必要がある。しかしながら、より小さく磁区をより薄い 磁性膜で実現すると、磁区の体積が小さくなるため、熱 ゆらぎの影響を受け易くなる。磁化された磁区は、通常 は、逆方向の磁界の印加によらない限り磁化が維持され る。しかしながら、実際は、熱ゆらぎによって磁化が経 時的に僅かずつ解消してしまう。従って、磁区が絶対容 度に冷却されいない限り、永久的な遊化状態の保持とい うのは不可能である。磁気記録媒体において、この熱ゆ ちぎの問題が極端に現れると、記憶した情報が数年後に 部分的に消滅するという事態になり得る。遊気記録媒体 が半永久的なデータ保存用として用いられている場合、 この事態は深刻である。

【0004】熱ゆらぎは、磁化された粒子が熱振動によ って道向きに反転して磁化されてしまう熱磁気緩和現象 である。特に、磁化遷移領域に近い場所の磁化粒子は、 隣接する磁区からの反転磁界の影響を受け、逆向きに反 転磁化される熱磁気緩和が生じやすい。長手方向記録に おいて面記録密度を高くしていくと、磁区の体積が小さ 50 くなるので、相対的に磁化遷移領域が大きくなる。この

ため、熱ゆらぎを影響を受け易い。一方、量直磁気記録 では、記録層の厚さ方向に磁化することで信号を記録す るので、磁区が狭くなっても磁区の厚さを確保すること で体積をかせぐことができる。このため、磁化強度を確 保したり、熱ゆらぎの影響を抑えたりすることが可能と なる。このようなことから、100ギガビット/平方イ ンチ以上の次世代の磁気記録媒体においては、垂直記録 方式が一般的になるだろうと言われている。

[00005]

気記録の真用化にはまだ多くの課題が残されており、そ の一つが低ノイズ化である。本類の発明は、このような 状況を脅魔して成されたものであり、垂直磁気記録媒体 の低ノイズ化を解決課題としている。

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた め、本願の請求項1記載の発明は、基仮と、この基板上 に形成された磁気記録圏とより成り、磁気記録層は基板 に垂直な方向での磁化により記録が行われる垂直磁化層 である量直遊気記録媒体であって、前記量直遊化層にお ける磁化の方向がより垂直な方向に向くようにする裏打 ち層が垂直磁化層の基板側に設けられており、さらに、 裏打ち層は論層された複数の軟磁性騰より成るものであ ってそれら少なくとも一つの界面には、裏打ち層におけ る磁壁発生を抑制する中間層が設けられているという機 成を有する。また、上記課題を解決するため、請求項2 記載の発明は、前記請求項1の機成において、前記中間 層は、その中間層を挟んで隣接する一対の前記軟磁性膜 を層間反強磁性結合させるものであるという構成を有す る。また、上記課題を解決するため、 請求項3記載の発 30 明は、前記請求項2の構成において、前記中間層は、ル テニウム、イリジウム、銅。ロジウム、バナジウム、ク ロム、ニオブ、モリブデン、タンタル、タングステン又 はレニウムを含む膜から成るという構成を有する。ま た. 上記課題を解決するため、請求項4記載の発明は、 前記請求項1.2又は3の構成において、前記複数の歌 磁性膜は、同じ付料であるという構成を有する。また、 上記課題を解決するため、論求項5記載の発明は、基板 と、この基板上に形成された磁気記録層とより成り、磁 気記録層は基板に垂直な方向での磁化により記録が行わ 40 れる垂直磁化層である垂直磁気配線媒体を製造する垂直 磁気記録媒体製造方法であって、裏打ち層を基板上に形 成する裏打ち層形成工程と、裏打ち層形成工程の後、垂 直磁化圏を形成する垂直磁化圏形成工程とを有してお り、前記裏打ち屠形成工程は、軟磁性膜を作成した後、 この上にその軟砂性膜における磁型発生を抑制する中間 層を形成し、さらにこの中間層の上に別の軟磁性膜を作 成する動作を有するという構成を有する。また、上記録 題を解決するため、請求項6記載の発明は、前記請求項 5の構成において、前記中間層は、その中間層を抜んで 50 り. さらに、その境界部分に、裏打ち層22における磁

隣接する一対の前記象磁性膜を層間反張磁性結合させる 膜から成るという構成を有する。また、上記舞題を解決 するため、請求項7記載の発明は、前記請求項6の構成 において、前記中間層形成工程は、前記層間反強磁性箱 台させる順を作成する工程であって、前記別の軟磁性膜 の上にこの順を作成する工程と、その上にさらに別の歌 磁性膜を作成する動作を1回以上繰り返すという構成を 有する。また、上記課題を解決するため、請求項8記載 の発明は、前記請求項6又は7の構成において、前記層 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、垂直磁 10 間反強磁性結合させる腺は、ルテニウム、イリジウム、 銅、ロジウム、バナジウム、クロム、ニオブ、モリブデ ン、タンタル、タングステン又はレニウム又はロジウム を含む膜であるという構成を有する。また、上記課題を 解決するため、闘求項9記載の発明は、前記請求項5乃 至8いずれかの構成において、前記軟磁性層は、すべて 同じ材料であるという機成を有する。

[0007]

【発明の実施の形態】以下、本願発明の実施の形態(以 下、実施形態)について説明する。 図 1 は、本願発明の 実施形態に係る磁気記録媒体の断面概略図である。図1 に示す磁気記録媒体は、ディスク状の基板1と、基板1 上に形成された磁気記録者とより成っている。磁気記録 圏は、基板1に垂直な方向での磁化により記録が行われ る垂直磁化層21である。そして、本実施形態の磁気記 録媒体は、垂直磁化層21に加え、垂直磁化層21の基 板1側に裏打ち層22が設けられた構造となっている。 【0008】裏打ち屋22は、垂直磁化層21における 磁化の方向がより垂直な方向に向くようにするものであ る。図2は、裏打ち層22の作用について説明する図で ある。図2(1)に示すように、不図示の磁気ヘッドに よって情報の記録を行う場合、磁気へッドによる磁界 は、垂直磁化層21に対して垂直な成分を多く有してい るものの、垂直磁化層21の下端付近ではどうしても発 散した磁界となり易い。このため、このままであると、 量直磁化層21が下側部分で量直磁気異方性(垂直方向 での保磁力が強くなる異方性)が低下し易い。また、磁 気ヘッドに戻ってくる磁束が磁界の発散により少なくな り易いため、磁化強度を高くすることが凝しいという間 題もある。

【0009】一方、透磁率の高い敏磁性膜より成る裏打 ち層22を垂直磁化層21の下側に設けると、磁束が裏 打ち層22に集まるため磁束の発散を抑制できる。 この 箱果、図2(2)に示すように、磁気ヘッドからの磁束 は垂直磁化層21の下端付近でもより垂直になり、垂直 磁気異方性が高く維持される。また、磁化強度も容易に 高くできる。

【0010】本実施形態の磁気記録媒体の大きな特徴点 は、上述した裏打ち層22が、軟磁性膜の単層構造では なく、複数の裏打ち圏22から成る多層構造となってお

壁形成を抑制する中間層23が設けられている点であ る。具体的には、図1に示すように、裏打ち圏22は三 層に分かれており、その間にそれぞれ中間層23が挿入 されている。

【0011】中間圏23の採用は、二層型垂直磁気記録 媒体特有のノイズについての発明者の研究の成果であ る。二層型垂直磁気配録媒体では、スパイクノイズとい う特有のノイズが発生することが確認されている。スパ イクノイズとは、出力健身の中にリップル状のノイズ信 号が現れる現象である。スパイクノイズは、媒体のある 10 部分で局所的に生ずることが判っており、 裏打ち磨22 の軟磁性膜に生じる磁壁が原因であると考えられてい

【0012】本願の発明者がスパイクノイズの低減につ いて鋭意研究したところ。 裏打ち屋22中にある村料の 圏を挿入することでスパイクノイズが低減させることが できることが判ってきた。具体的には裏打ち層22を二 つの層に分割し、その間に非磁性膜を設けるとスパイク ノイズが低減させることができる。図3は、中間層23 による磁壁の低減について説明した図であり、裏打ち圏 22の遊化状態について模式的に示した図である。この うち、図3(1-1),(2-1)は断面図、(1-2). (2-2)は裏打ち層22の部分の平面図であ

【0013】上途したように、裏打ち層22としては、 **敏磁性膜のような透磁率の高い膜が形成される。通常、** このような順は、ある大きさの結晶から成っている。結 晶の方向は、成膜時の環境によってある程度の方向性を 持つ場合が多いが、基本的には図3(1-2)に示すよ うに、ランダムである。いずれにしても、このような裏 30 打ち層22が垂直磁化層21の磁化とともに磁化された 際、結晶の方向に異なる向きに磁化されるため、図3 (1-1), (1-2)に示すように、磁壁24が発生 し易い。一方、裏打ち層22を二つに分割し、その間に 非磁性体より成る中間層23を設けると、図3(2-1)、(2-2)に示すように、磁化の向きがそろい易 くなるため、磁量24の発生を抑制することができる。 本実施形態では、特に、二つの裏打ち層22が層間結合 を行うよう上記中間層23を構成しており、さらに磁壁 24の形成を抑制するようになっている。以下、この点 40 設ける。裏打ち層22は、全体で100ヵm程度とす について説明する。

【0014】層間結合は、原子間の磁気モーメントの伝 導電子を媒介とした相互作用の一つであり、希土類金属 等にみられる間接交換相互作用(RKKY相互作用)の 一つである。間接交換相互作用では、個電子数Nではな くスピン粒子間の距離により、その相互作用の符号が正 《強磁性的》になったり)、負(反強磁性的)になった りする。その周期は、伝導電子のパンド、特にフェルミ 面の構造に依存するが、本実施彩態では、このうち反強 磁性的な結合が行われる部分を選択する。

【0015】具体的には、中間層23としてルテニウム 膜を厚さ0.8nm程度で形成し、中間層23を挟む二 つの裏打ち屋22を屋間反強磁性結合させる。この結 早、裏打ち層22に生じていた磁壁24が少なくなり、 スパイクノイズをさらに低減させることができる。つま り、ルテニウム膜による反張磁性結合のように強い層間 植合が生じていると、各裏打ち圏22内の結晶の方向性 により磁化の向きが決まる傾向よりも、層間結合により 層毎に揃った向きに磁化される傾向の方が支配的になる (図3(2-1), (2-2))。このため、磁壁24 の発生がさらに抑制できるのである。

6

【0016】との他、本願発明は、益板1と最下層の裏 打ち暑22との間に第一下地層3を有する。第一下地層 3は、シード層とも呼ばれ、裏打ち層22の結晶化度や 結晶の配向等を調御するためのものである。第一下地圏 3としては任意の材料が選択できるが、 Ta 膜、 CoC r 膜等が採用できる。また、最上層の裏打ち層22と垂 直磁化層21との間には、第二下地層4が設けられてい る。第二下地層4は、上層の垂直磁化層21の結晶度や 結晶の配向等を制御するためのものであり、同様にTa 順令CoCェ膜等が採用できる。また、垂直磁化層21 の上には保護層ちが形成されている。保護圏ちも任意の 材料が採用でき、Ta膜、ダイヤモンドライクカーボン (DLC) 膜等である。

【0017】次に、本願発明の他の実施影應について説 明する。図4は、本類発明の別の実施形態に係る磁気配 **録媒体の断面概略図である。図1に示す真施形態では、** 裏打ち層22は三分割されたが、図4に示す各実施影態 では、別の分割数となっている。即ち、図4(1)は二 分割。(2)は四分割、(3)は五分割、(4)は六分 割、(5)は七分割となっている。より細かく分割して 各境界部分に中間圏23を設けて層間結合させると、圏 間結合がより強くなり、磁壁発生をさらに低減させるこ とができる。

[0018]

【実施例】以下、上記真施形態の属する真施例について 説明する。基板 1 はガラス製であり、この上に下地圏 3 としてTa膜を5ヵm程度の厚さで設ける。そして、下 地層3の上には、裏打ち層22としてN:Fe合金膜を る。つまり、図1に示す実施形態では、各裏打ち層22 の厚さは33.3nm程度、図4(1)に示す実施影態 では50nm程度、(3)では25nm程度、(4)で は20nm程度。(5)では16.17nm程度。 (6)では14.29nm程度とする。中間層23とし ては、いずれの実施形態においても、ルテニウム膜を 8 n m程度で設ける。これにより、各裏打ち層22 が層間反強磁性結合し、磁壁発生抑制の効果が高く得ら れる。尚、層間反強磁性結合が得られる中間層23の厚 さは、材料により若干具なるが、0.8~18nm程度

である。ルテニウムの場合は①、8ヵmであるが、Cェ の場合には1.8nmである。

【0019】また、製造方法としては、最下層の裏打ち 圏22の上に中間圏22を形成した後、この上にさらに 裏打ち層22を形成し、さらにその上に中間層22を形 成する。そして、この裏打ち層22の形成と中間層22 とを所定回数繰り返す。垂直磁化層21として、CoC rPtB順を10~15nm程度の厚さで設ける。そし て、その上に、保護圏5としてカーボン膜を5mm程度 リングにより作成することができ、マグネトロンスパッ タリングによると、成膜速度が高く生産性の点で好まし Ļs.

【0020】上記各実施形態及び各実施例では、裏打ち 屋22の材料としてN:Fe膜が使用されたが、N:F eNb膜、FeTaC膜、CoNbZr膜、CoTa2 r膜等でもよい。尚、分割された裏打ち層22がすべて 同じ付料である必要はなく、冥種材料の裏打ち層22で あってよい。但し、同じ材料にしておくと、スパッタリ ングの際に同じターゲットが使用できる等、製造上のメ 20 リットが大きい。

【0021】また、中間層23としては、ルテニウムの 他、イリジウム (!r)、銅 (Cu)、Rh (ロジウ ム) バナジウム (V) 、クロム (Cr) 、ニオブ (N b) 、モリブデン (Mo) 、タンタル (Ta) 、タング ステン (W) 又はレニウム (Re) より成る膜であって も良い。尚、中間層23は、裏打ち層22における磁盤 発生の抑制ができる限り、これらの元素単体から成る膜 であってもよいし、これらの元素を合金又は化合物の形 で含む膜であっても良い。これらの材料の中では、ルテ ニウムが、高い暑間反強磁性結合を生じさせる作用があ り、より好ましい。尚、裏打ち圏22が三層以上の多層 膜であっても、挿入される中間圏23は少なくとも一層 あれば足り、磁壁発生抑制の効果が得られる。

【0022】また、本類発明が対象とする垂直磁気記録 媒体は、ハードディスクの他、フレキシブルディスクや 2 I Pディスクのような他の媒体でもよい。また、光磁* * 気ディスク (MOディスク) のような磁気の作用ととも に磁気以外の作用を利用する記録媒体についても、本類 発明を利用することができる。さらに、磁気記録媒体の 用語は最も広く解釈されるものであり、MRAM(Maon etic Random Access Memory)のような磁気の作用を使用 した半導体メモリ等も含まれる。

[0023]

【発明の効果】以上説明した通り、本願の請求項1又は 5の発明によれば、中間層により裏打ち層中の磁壁発生 の厚さで設ける。尚、各暑の薄膜は、いずれもスパッタ 10 が抑制されるので、スパイクノイズが低減された高性能 の垂直磁気記録媒体が得られる。また、請求項2又は6 の発明によれば、上記効果に加え、中間圏を挟む二つの 裏打ち層が層間反強磁性結合するので、磁壁発生がさら に抑制される。このため、スパイクノイズがさらに低減 される。また、 記求項4又は9記載の発明によれば、彼 数の裏打ち層が同じ材料であるので、製造上のメリット が大きいという効果が得られる。

【図面の節単な説明】

【図1】本願発明の実施形態に係る磁気記錄媒体の断面 機略図である。

【図2】裏打ち層22の作用について説明する図であ る.

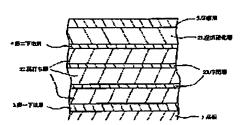
【図3】中間層23による磁壁の低減について説明する 断面図であり、裏打ち屋22の磁化状態について模式的 に示した図である。

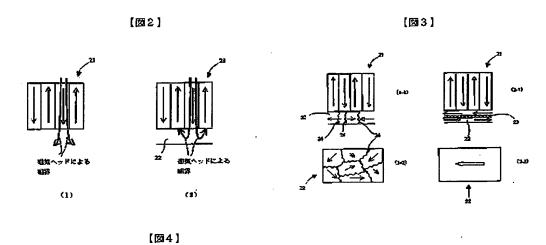
【図4】本類発明の別の実施形態に係る磁気記録媒体の 断面概略図である。

【符号の説明】

- 1 華板
- 21 **垂直磁化層**
- 22 泉打ち層
- 23 中間圏
- 24
- 3 第一下地膜
- 第二下地號
- 保護屋

【図1】





フロントページの続き

Fターム(参考) 50006 CA03 CA05 CA06 DA03 DA08

FA09

50112 AA03 AA24 BD03 FA04

5EG49 BA08 DB12 GC01